

阴极真空弧离子源的研制

张孝吉, 张荟星, 周凤生, 吴先映, 李强, 刘风华

北京师范大学低能核物理所; 北京市辐射中心

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

为发展金属离子束材料表面改性技术的工业应用, 北师大低能核物理所研制成阴极真空弧离子源和离子注入装置. 简要介绍该设备的结构、原理和性能.

The cathode vacuum arc ion source and ion implantation facility have been developed in our institute for industrial application of surface modification of materials. In this paper the principle structure and performance of these facilities were described.

关键词 [真空弧放电](#) [MEVVA离子源](#) [离子注入](#) [表面改性](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [张孝吉](#); [张荟星](#); [周凤生](#); [吴先映](#); [李强](#); [刘风华](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (99KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“真空弧放电”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [张孝吉](#)

· [张荟星](#)

· [周凤生](#)

· [吴先映](#)

· [李强](#)

· [刘风华](#)